Standart ve gözenekli WO₃ filmlerin hazırlanması ve kıyaslanması

Esra ÖZKAN ZAYİM^{*}, Fatma Z. TEPEHAN

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

Özet

Bu çalışmada, standart ve gözenekli WO_3 filmler, başlangıç malzemesi olarak tungsten hekzaklorit (WCl_6) ve ethanol kullanılarak sol-gel yöntemlerinden olan döndürme tekniğiyle hazırlanmıştır. Gözenekli tungsten oksit filmler, tungsten oksit solune dört farklı tip polimer eklenerek kaplanmıştır. Söz konusu polimerler: (BASFTM Pluronic p_{123}) (p_1), poly(ethylene glycol) (p_2), polyethylene glycol-ran-propylene glycol (p_3) ve polystyrene-co-allyl-alchl (p_4)'dır. Bu polimerler kullanılarak gözenekli WO_3 filmler hazırlanmış ve filmlerin optik, yapısal ve elektrokromik özellikleri standart (s_1) WO_3 filmler ile kıyaslanmıştır. Filmlerden UV aydınlatma yöntemi ile polimer kalıpların uzaklaştırılması başarılmıştır. Aynı zamanda UV aydınlatma işlemi uygulanmış tungsten oksit filmlerin renklenme etkinliği değerlerinde düzelme gözlenmiştir. **Anahtar Kelimeler**: Elektrokromism, gözenekli WO_3 filmler, iyon giriş-çıkış kinetiği, sol-gel, uv aydınlatma.

Preparation and comparison of standard and mesoporous WO₃ films Abstract

In this study, standard and mesoporous sol-gel WO_3 thin films were prepared by a spin coating technique from an ethanolic solution of tungsten hexachloride (WCl_6). Different types of polymers were employed as a template to generate the mesoporous structure. These polymers: (BASFTM Pluronic p_{123}) (p_1), poly(ethylene glycol) (p_2), polyethylene glycol-ran-propylene glycol (p_3) and polystyrene-co-allyl-alchl (p_4). To avoid the varying degrees of crystallinity as a result of thermal treatment, a UV illumination method has been employed to remove the polymer surfactant. This room temperature approach uses ozone generated during UV illumination in air to oxidize the organic compounds. The electrochromic and optical properties of the mesoporous films are described and compared to standard sol-gel WO_3 films. Results are also presented on the samples prepared by thermal treatment. We demonstrate that the UV illumination treatment is a superior method to remove templates which enables us to more effectively investigate the effect of mesoporosity on the electrokinetics of ion insertion into $_{WO3}$ films. These mesoporous materials exhibit superior high rate ioninsertion performance when used as electrochromic layers, which is attributed to the high surface area of mesoporous WO_3 . The films were characterized by using transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), X-ray diffraction (XRD), ellipsometre and cyclic voltammetry.

Keywords: Electrochromism, insertion kinetics, mesoporous WO₃ films, sol-gel, uv illumination.

^{*}Yazışmaların yapılacağı yazar: Esra ÖZKAN ZAYİM. ozesra@itu.edu.tr; Tel: (212) 285 69 63.

Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde tamamlanmış olan "Tungsten oksit ve katkılı tungsten oksit ince filmlerin hazırlanmasi ve karakterizasyonu" adlı doktora tezinden hazırlanmıştır. Makale metni 17.04.2002 tarihinde dergiye ulaşmış, 25.09.2002 tarihinde basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar 31.05.2003 tarihine kadar dergiye gönderilmelidir.

Giriş

"Surfactant-templated mesoporous" malzemelerin kesfinden bu yana, kalıp (templating) metotları oksitlerinde geçiş metal geniş olarak kullanılmaktadır (Kresge v. diğ., 1992). Gözenekli (mesoporous) metal oksitler, katalizör, elektrokatalizör ve elektrokromik malzemelerde genis uygulama alanları bulmaktadır (Antonelli ve Ying, 1996; Liu v. diğ., 1997). Bu uygulamalarda iyon giris-cıkış işlemi sırasında, geniş yüzey alanı nedeniyle gözenekli filmlerin kinetik performansının düzelmesi beklenmektedir. Son zamanlarda iyonik olmayan polimerler (surfactantlar, yüzey gerilimini azaltan malzemeler) kalıp (templates) olarak kullanılmaktadır ve bu amaçla çok sayıda metal oksit sentezlenmiştir (Prakash v. diğ., 1995; Yang v. diğ., 1998; Yang v. diğ., 1999; Yusuf v. diğ., 2001). Genelde "kalıplar" organik çözücü ya da ısıl işlem kullanılarak uzaklaştırılabilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, gözenekli tungsten oksit filmler isil islem (300°C) voluvla elde edilmis ve elektrokromik filmlerin kinetik özelliklerinde belirgin düzelme gözlenmistir (Cheng v. diğ., 2001; Ozkan v. diğ., 2001; Ozkan v. diğ., 2002). 300°C "surfactant"1 tamamen uzaklaştırmak için yeterli bir sıcaklık olup, bu sıcaklıkta gözenekli filmler hala amorf kalmakta iken, aynı sıcaklıkta standart filmlerin kristalleşmeye başladığı gözlenmiştir. Bu çalışmada standart sol-gel kaplı filmlerle, gözenekli

filmlerin elektrokromik özellikleri de kıyaslanmıştır. Polimerler "calcination" (2 saat süre ile 300°C ve 400°C ısıl işlem uygulanarak kopolimeri filmlerden uzaklaştırma işlemidir) ve yeni geliştirilen UV aydınlatma (Novel ultraviolet (UV) illumination) metotlarıyla uzaklaştırılmıştır. Gözenekli filmler renklenme ve saydam hale gelme işlemleri sırasında daha iyi bir kinetik göstermişlerdir.

Deneysel kısım

Sollerin hazırlanması ve kaplama şartları

Bu çalışmada beş farklı tungsten oksit solu hazırlanmıştır. Sol-gel kaplı filmler döndürme yöntemiyle hazırlanmış olup kaplama hızı 2000 dev/dak.dır. Standart sol, 1 gr WCl₆ (Aldrich) ve 10 gr ethanol karıştırılarak elde edilmiştir. Gözenekli tungsten oksit filmlerde aynı sol kullanılarak her bir sole sırasıyla 0.25 grpolimerler,

i.) tri-blok kopolimer p_{123} (p_1), (HO(CH₂-CH₂O)₂₀(CH₂CH(CH₃)O)₇₀(CH₂CH₂O)₂0H)

ii.) poly (ethylene glycol) (p₂), (H(OCH₂CH₂)nOH)

iii.) polyethylene glycol-ran-propylene glycol (p₃), H(OCH₂CH₂)_x[OCH₂CH-(CH₃)]_yOH

iv.) poly(styrene-co-allyl-alcohol) (p₄),

 $[-CH_2CH(C_6H_5)-]_x[-CH_2CH-(CH_2OH)-]_y$

eklenerek hazırlanmıştır. Tablo 1'de bu çalışmada kullanılan örnekler özetlenmiştir.

Örnek Tanımı	Hazırlama ve ısıl işlem şartları
s ₁	(As-deposited) standart sol-gel film
p ₁	(As-deposited mesoporous) gözenekli film
s ₁ _sıcaklık değeri, s ₁ _300 gibi	1°C/dak.ya da 10°C/dak. hızla arttırılan sıcaklıkta 2 saat boyunca ısıl işleme tabi tutulmuş sol-gel film, 300°C gibi
p ₁ _sıcaklık değeri, p ₁ _300 gibi	1°C/dak. ya da 10°C/dak. hızla arttırılan sıcaklıkta 2 saat boyunca ısıl işleme tabi tutulmuş gözenekli sol-gel film, 300°C gibi
s ₁ _uv	Oda sıcaklığında kısa dalgaboyunda UV aydınlatma uygulanmış sol-gel film
p ₁ _uv	Oda sıcaklığında kısa dalgaboyunda UV aydınlatma uygulanmış gözenekli sol-gel film

Tablo 1. Bu çalışmada değerlendirilen tungsten oksit malzemelerin tanımı ve hazırlama şartları

Filmlerin karakterizasyonu

Filmlerin, yüzey analizleri transmisyon elektron mikroskobu (TEM), Phillips CM 30 "transmission electron microscope", atomik kuvvet mikroskobu (AFM), Auto Probe "atomic microscope" ve taramalı elektron force mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmıştır. X-ışınları difraksiyonu (X-Ray diffraction, XRD) ölçümleri Scintag X-1 diffraktometer cihazı kullanılarak (Cu Κα radiation) gerçekleştirilmiştir. XRD ölcümleri 10-60° aralığında 0.02° adımlarla yapılmıştır. Elektrokimyasal deneyler "Arbin battery testing system (Arbin Instruments, TX. USA)" kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal olarak Li⁺ iyonunun a-WO_{3-y} filmlerinin içine enjeksiyonu ve uzaklaştırılması 1 M (propylene carbonate) LiClO₄/PC icinde. referans ve sayıcı (counter) elektrot olarak lityum metali kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ITO (Indium Tin Oxide) taşıyıcı üzerine kaplanan tungsten oksit filmler çalışma elektrotu (working electrode) olarak kullanılmış

ve üç elektrot konfigürasyonu kullanılarak elektrokromik özellikler incelenmiştir. Filmlerin optik sabitleri "n&k 1280" analizörü ve ellipsometre kullanılarak ölçülmüştür. Filmlerin kimyasal kompozisyonları infrared spektoroskopisiyle (FTIR) incelenmiştir.

Filmlerin FTIR sonuçları

Dört farklı tip polimer kullanılarak hazırlanmıs gözenekli tungsten oksit filmlerin kimyasal komposizyonu infrared spektoroskopisiyle arastırılmıştır. IR sonuçları, UV ve ısıl işlem yöntemiyle polimerin etkin bir sekilde uzaklastırıldığını göstermektedir. Şekil 1'de oda sıcakkaplanmış standart lığında ve gözenekli tungsten oksit filmlerin FTIR sonucları verilmiştir. Şekil 2 (a-c)'de s₁, p₁ ve p₂ gözenekli filmlerin sırasıyla oda sıcaklığında, isil ve UV aydinlatma (UV illumination) işlemleri uygulandıktan sonra FTIR sonuçları verilmiştir. Şekil 2 (a-c)'deki filmler cam taşıyıcılar (Corning Glass) üzerine kaplanmıştır.



Şekil 1. Oda sıcaklığında cam taşıyıcı üzerine kaplanmış standart ve gözenekli WO₃ filmlerin FTIR spektrumları



Şekil 2. Cam taşıyıcı üzerine kaplanmış WO_3 filmlerin FTIR spektrumları (a) s_1_300 , s_1_uv ve s_1_RT (b) p_1_300 , p_1_uv ve p_1_RT

Bütün bu eğrilerde soğurma çok küçük olmasına rağmen, s₁ hariç, oda sıcaklığında 2900 cm⁻¹ ve 1300-1500 cm⁻¹ bölgelerinde bantlar olusmustur. Bu bantlar CH, CH₂, CH₃ karbon/hidrojen titreşimlerinden kaynaklanmak-tadır. p_1 örnekleri icin 1650 cm⁻¹'de C=C titresimini (stretch vibration) gösteren ilave bir pik daha işaretlenmiş olmasına rağmen bunun çoklu iç yansımalardan kaynaklanan spektrumdaki girisim patternlerinden biri olup olmadığını söylemek zordur. Buna rağmen s₁ polimer içermediği halde, oda sıcaklığında kaplanan filmlerde (as-deposited) ve UV avdınlatma

uygulanmış filmlerde 1650 cm⁻¹'deki bu özelliği sergilerken ısıl işlem uygulanmış örneklerde bu pik gözlenmemiştir. Oda sıcaklığı (RT) spektrumları, UV ve ısıl işlem uygulandıktan sonra alınan spektrumlarla kıyaslandığında, -CH soğurma bantlarının yok olduğu gözlenmiştir.

Filmlerin yapısal özellikleri

Şekil 3'te farklı sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanmış standart ve gözenekli WO₃ filmlerin XRD spektrumları verilmiştir. Standart ve gözenekli tungsten oksit filmler 350°C ve 400°C'de 2 saat süreyle hava ortamında ısıl işleme tabi tutulmuşlardır.



Şekil 3. (a) 350°C'de (b) 400°C'de 2 saat süreyle ısıl işlem uygulanmış filmlerin XRD spektrumları

Sekil 3 (a)'da 350°C'de ısıl işleme tabi tutulmuş gözenekli ve standart tungsten oksit filmlerin XRD spektrumları verilmiştir. 350°C'de ısıl işlem uygulanmış s₁ örnekleri kristalleşmeye başlamışken bütün gözenekli filmler amorf fazda kalmaktadır, gözenekli yapı filmlerin kristalleşmesini geciktirmektedir. p1, p2 ve p3 örnekleri ancak 400°C'de (Şekil 3 (b)) kristallesmeye başlamışken p₄ filmlerinin 2 saat süresince 400°C'de ısıl işleme tabi tutulmaları, kristalleşmeleri için yeterli olmamıştır. Şekil 3 (a)'daki spektrumun spektral dekonvolusyon analizleri 20 değeri için sırasıyla üç pik tanımlamıştır bunlar : 23.14°, 23.64° ve 24.36°'dır. Bu pikler triklinik kristal yapısına karşılık gelmektedir ve sırasıyla (002), (020) ve (200) kırınımlarını göstermektedir. Gözenekli tungsten oksit filmlerin kristalleşmesindeki gecikme kalıcı polimer templatelerin 200°C'den geçiş sırasında dekompozisyona 300°C'ye uğramasından kaynaklanmaktadır (Yang, 1999). Diğer yandan UV aydınlatma uygulanan bütün filmler tamamen amorf yapıda kalmaktadır.

Filmlerin yüzey morfolojilerindeki değişim TEM, SEM ve AFM fotoğrafları alınarak incelenmistir. Farklı tip polimer kullanılarak hazırlanmış tungsten oksit filmlerinin yapısal özelliklerine, polimer cinsinin etkisi de araştırılmıştır. TEM, SEM ve AFM fotoğraflarından polimer tipinin gözenekli filmlerin yapısal özelliklerini değiştirdiği gözlenmiştir. Şekil 4 (a, b)'de p1 ve p4 filmlerinin gözenekli yapıları TEM fotoğrafları ile belirlenmiştir. p1, p2 ve p4 filmleri için UV işlem, p3 filmleri için ise 300°C'de ısıl işlem uygulandıktan sonra TEM fotoğrafi alınmıştır. TEM fotoğrafları, p4 filmlerinde gözenekli yapının daha düzenli ve belirgin olduğunu göstermekle beraber bütün bu farklı polimerler kullanılarak hazırlanmış filmlerin gözenekli yapıya sahip olduğu görülmüştür. kullanılarak hazırlanmış p_1 gözenekli filmlerde yapı düzenli olmamakla beraber tüm filmler için gözenek çapı yaklaşık 10 nm'dir. p₂, p₁ ile yaklaşık aynı davranışı sergilemekle beraber gözenekli yapı daha belirgindir. p2 ve p4 filmleri yaklaşık 6-10 nm çapında gözenekli yapı göstermiştir. Bütün bu "surfactant"lar, tungsten oksit filmlerin mikro yapısında çok temel değişiklikler yapmıştır.





Şekil. 4. Gözenekli tungsten oksit filmlerin TEM fotoğrafları (a) p_1 300 (b) p_4 uv

Şekil 5 (a-e)'de ısıl işlem uygulanmış s₁_300, p₁_300, p₂_300, p₃_300 ve p₄_300 filmlerinin SEM fotoğrafları verilmiştir. s₁, p₁ ve p₂ örnekleri benzer yapıya sahipken p₁ ve p₂ kullanılarak hazırlanmış filmler s₁ filmlerine göre daha gözenekli yapı göstermişlerdir. Bunun yanında p₃ ve p₄ kullanılarak hazırlanmış gözenekli filmlerin mikro-yapıları tamamen değişmiştir.

Şekil 6 (a, b) ısıl işlem uygulanmış (calcined) s_1 ve p_4 filmlerin, AFM resimlerini göstermektedir. s_1 örneği homojen bir yapıya sahiptir. p_1 kullanılarak hazırlanmış gözenekli tungsten oksit filmler, kopolimer "surfactant" ları ayrıştırarak (decompose) gaz evolusyonu oluşturdukları için çatlak bir yapıya sahiptirler. Bütün gözenekli filmlerin tanecik yapısı s_1 'e göre daha büyüktür.



600nm 50000X (b)



(a)



P2

1µm 40000X

(c)

(d)



2μm 30000X

(e) Şekil 5. Isıl işlem uygulanarak (calcination) "surfactant" uzaklaştırılmış filmlerin SEM fotoğrafları (a) s_1_300 (b) p_1_300 (c) p_2_300 (d) p_3_300 (e) p_4_300

E. Özkan Zayim, F. Z. Tepehan



Şekil.6. Isıl işlem uygulanmış tungsten oksit filmlerin AFM fotoğrafları (a) s_1 300 (b) p_4 300

p₃ ve p₄ filmlerin SEM fotoğraflarında gözüken yapısal özelliklerindeki farklılık, AFM fotoğraflarında da kendini göstermektedir.

Filmlerin optik özellikleri

Şekil 7'de s_1_uv , p_1_uv , p_2_uv ve p_3_uv filmlerinin optik özellikleri ellipsometre ile ölçülmüştür.

Şekil 7 (a) ve 7 (b) ellipsometre kullanı-larak ölçülmüş kırma indisleri ve söndürme katsayılarını vermektedir. p₄ filmler saydam bir yapıya sahip olmadıkları için ellipsometre kullanılarak bu filmlerin optik özellikleri hesaplanamamıştır. Ellipsometre sonuçlarına göre uv aydınlatma işlemi uygulanmış bütün



Şekil 7. s₁_uv, p₁_uv, p₂_uv, p₃_uv filmlerin ellipsometre kullanılarak ölçülmüş (a) kırma indisi (b) söndürme katsayısı değerleri

gözenekli tungsten oksit filmlerin kırma indisi değerleri, uv işlem uygulanmış standart tungsten oksit filmlerin kırma indisi değerlerine göre küçüktür ve yaklaşık olarak bütün gözenekli filmlerin kırma indisi değerleri birbirine yakın olup dalgaboyuna karsı aynı davranısı sergilemişlerdir. Filmlerin optik özelliklerindeki davranış morfolojilerini bu da yüzey desteklemektedir. Kırma indisindeki bu azalma vapının gözenekli olduğunu gösteren başka bir delildir. Şekil 7 (a)'da, görüldüğü gibi 550 nm dalgaboyu değerinde s₁ filmleri için n=2.00 iken diğer bütün gözenekli tungsten oksit filmlerin

indisi değerleri çok miktarda kırma az değişmekle beraber aynı kalmıştır. p₁- p₃ filmleri için 550 nm de kırma indisi yaklaşık 1.88 olarak ölçülmüştür. 633 nm dalgaboyu değerinde ise s₁ filmlerinin kırma indisi değeri 1.97 olarak ölçülmüşken, p_1 ve p_3 için n =1.86 değerindedir. Bilindiği gibi gözenekli yapı filmlerin kırma indisi değerini azaltmaktadır (Fujino v. diğ., 1987; Green ve Hussain, 1991). Gözenekli tungsten oksit filmler hazırlayarak kırma indisi değerini kontrol etmek mümkündür. Farklı miktarlarda "surfactant" eklenerek daha fazla gözenekli yapıya sahip filmler hazırlanarak daha

düşük n değerine sahip filmler elde edilebilir. Şekil 7 (b)'de dalgaboyuna karşı filmlerin söndürme katsayısı değerleri verilmiştir. s_1 ve p_2 filmler geçirgen oldukları için söndürme katsayısı (k) değerleri sıfıra yakındır. 550 nm dalgaboyunda s_1 ve p_2 filmleri için $k=8.84 \times 10^{-5}$ olarak bulunmuştur. 550 nm dalgaboyunda p_1 filmleri için, $k=3.36 \times 10^{-3}$ ve p_3 filmleri için $k=1.25 \times 10^{-2}$ olarak bulunmuştur. 633 nm dalgaboyunda ise s_1 ve p_2 için $k=4.11 \times 10^{-5}$, p_1 için $k=2.70 \times 10^{-3}$ ve p_3 için $k=1.00 \times 10^{-2}$ olarak bulunmuştur.

Filmlerin elektrokimyasal özellikleri

Bu kısımda gözenekli ve standart sol-gel kaplı tungsten oksit filmlerin elektrokimyasal özelliklerinden bahsedilmiştir. Şekil 8'de UV işleme tabi tutulmuş s₁ ve p₁ örneklerinin çevrimli voltametre sonuçları verilmiştir. p₁ örneklerinde kinetik performansın düzeldiği, 3.8 V'da tungsten oksit filmlerinden Li^+ iyonlarının tamamen uzaklaştığı ve aynı zamanda CV eğrilerinde 2.67 V'da çok belirgin bir anodik pik görülmektedir.

Şekil 9'da 300°C'de 1s1l işleme tabi tutulmuş s_1_300 , p_1_300 , p_2_300 , p_3_300 filmlerin 10mV/s tarama hızında alınmış çevrimli voltametre (CV) sonuçları verilmiştir. Bütün gözenekli tungsten oksit filmlerin CV eğrilerindeki

yük miktarı ve akım değeri daha büyüktür. p₁ ve p₃ filmleri aynı CV davranışı göstermişlerdir.

Elektrokromik malzemeler için önemli bir parametre cm²C⁻¹ şeklinde gösterilen renklenme etkinliğidir (CE). CE'yi hesaplayabilmek için birim alanın fonksiyonu olarak giren/çıkan yük miktarı ve optik yoğunluktaki (δ OD) değişiklik bilinmelidir.

Optik yoğunluk;

$$\delta OD(\lambda) = \log(T_o(\lambda)/T_c(\lambda))$$
(1)

olarak tanımlanmıştır. Burada $T_o(\lambda)$ ve $T_c(\lambda)$ saydam ve renkli filmlerin geçirgenliğidir.

Optik yoğunluktaki değişiklik birim alan başına iletilen yük, Q ile ilgilidir. İki değerden, renklenme etkinliği denklem 2'den hesaplanabilir.

$$CE(\lambda) = \delta OD(\lambda)/Q$$
 (2)

Tablo 2'de 650 nm dalgaboyunda filmlerin renklenme etkinliği (CE) değerleri verilmiştir. UV aydınlatma işlemi uygulanan filmlerde tersinirlik ve renklenme etkinliği ısıl işlem uygulanan filmlere göre daha iyidir. Isıl işlem uygulanmış filmlerde bir miktar kalıcı renklenme



Şekil 8. s_1 uv, p_1 uv filmlerinin 10mV/s tarama hızında alınmış CV eğrileri



Şekil 9. s₁ 300, p₁ 300, p₂ 300, p₃ 300 filmlerinin 10mV/s tarama hızında alınmış CV eğrileri

(residual coloration) gözlenmiştir. Literatürdeki renklenme etkinliği değerleri ile kıyaslandığında uv işlem uygulanmış filmlerin CE değerleri oldukça yüksektir (Bohnke v. diğ., 1982; Vroon ve Spee, 1997).

Tablo 2. 650 nm dalgaboyunda tungsten oksit filmlerin renklenme etkinliği

Malzeme	Renklenme Etkinliği (C ⁻¹ cm ²)
s ₁	64.25
s1_300	58.59
s ₁ _uv	70.07
p1_300	49.42
p_1_uv	60.73
p ₂ _300	16.33
p2_uv	27.71
p ₃ _300	26.76
p ₃ _uv	38.07
p4_uv	50.61

Sonuçlar

Sol-gel yöntemi ile "template" olarak inorganik "surfactant" kullanarak gözenekli filmler hazırlanmıştır. Filmlerin gözenek boyutları yaklaşık 6-10 nm civarındadır. Bu gözenekli filmler geniş yüzey alanları sayesinde elektrokromik tabaka olarak kullanıldıklarında oldukça yüksek performans göstermişlerdir. Gözenekli yapı filmlerin kinetik özelliklerinde iyileşmeye sebep olmuştur. Filmlerin optik özellikleri, yapıyı gözenekli hale getirerek kontrol edilebilir ve bu da kırma indisi değerlerinde gözenekli yapıya bağlı olarak azalmaya sebep olabilir. Isıl işlemin neden olduğu yapısal değişimleri önlemek için ve polimeri uzaklaştırmak için UV aydınlatma yöntemi geliştirilmiştir. UV aydınlatma işlemi, organik bileşikleri oksite ederken oda sıcaklığında ozon üretmektedir. Elektrokromik ve optik karakterizasyonlar, UV aydınlatma işlemi uygulanmış tungsten oksit filmlerin renklenme etkinliğinin belirgin şekilde arttığını göstermektedir. Farklı "non-ionic surfactant"lar kullanılarak hazırlanan gözenekli tungsten oksit filmler farklı yüzey özellikleri sergilemişlerdir. "Surfactant" filmlerin mikro-yapılarında büyük değişime neden olmuştur.

Semboller

- λ :Dalgaboyu (nm)
- n :Kırma indisi
- k :Söndürme katsayısı
- δOD :Optik yoğunluk

Kaynaklar

- Antonelli, D. M., Ying, J. Y., (1996). Synthesis and characterization of hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves, *Chem. Mater.*, **8**, 874.
- Bohnke, O., Bohnke, C., Robert, G. and Carquille, B., (1982). Electrochromism in WO₃ thin-films .1. LiClO₄-propylene carbonate water-electrolytes, *Solid State Ionics*, 6, 121-128.
- Cheng, W., Baudrin, E., Dunn, B., Zink, J. I., (2001). Synthesis and electrochromic properties of mesoporous tungsten oxide, *J. Mater. Chem.*, **11**, 92.
- Fujino, K., Tada, H., Kawahara, H., (1987) Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum Engr., 823, 124-129.
- Green, M., Hussain, Z., (1991). Optical-properties of dilute hydrogen tungsten bronze thin-films, J. Appl. Phys., 69, 7788-7796.
- Kresge, C. T., Leonowicz, M. E., Roth, W. J. J., Vartuli, C., and Beck, J. S., (1992). Ordered mesoporous molecular-sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism, *Nature*, **359**, 710.
- Liu, P. ,Liu, J., Sayari, A., (1997). Preparation of porous hafnium oxide in the presence of a

cationic surfactant, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 577.

- Ozkan, E., Lee, S., Liu, P., Tracy, C. E., Tepehan, F. Z., Pitts, J. P., and. Deb, S. K., (2001) *Proceedings in SPIE's Annual Meeting in San Diego*, 4458-22.
- Ozkan, E., Lee, S., Liu, P., Tracy, C. E., Tepehan, F. Z., Pitts, J. P., and. Deb, S. K., (2002). Electrochromic and optical properties of mesoporous tungsten oxide films, *Solid State Ionics*, 149, 139–146.
- Prakash, S. S., Brinker, C. J., Hurd, A. J., (1995). J. Non-Cryst. Solids 189, 66.
- Vroon, Z. A. E. P., Spee, C.I.M.A., (1997). Sol-gel coatings on large area glass sheets for electrochromic devices, *J. Non-Crystalline Solids* 218, 189-195.
- Yang, P. D., Zhao, D. Y., Margolese, D. I., Chmelka, B. F. and Stucky, G. D., (1998). Generalized syntheses of large-pore mesoporous metal oxides with semicrystalline frameworks, *Nature*, **396** (6707), 152.
- Yang, P. D., Zhao, D. Y., Margolese, D. I., Chmelka, B. F. and Stucky, G. D., (1999). Block copolymer templating syntheses of mesoporous metal oxides with large ordering lengths and semicrystalline framework, *Chem. Mater.*, **11(10)** 2813.
- Yusuf, M. M., Imai, H., Hirashima, H., (2001). Preparation of mesoporous TiO2 thin films by surfactant templating, *J. Non-Cryst. Solids*, 285, 90.